Mem. Fac. Educ. Ehime Univ., Nat. Sci., Vol. 15, No. 1 75~81 (1994)

セラミックス(Si₃N₄)と鉄基金属(Ni-Cr-Mo Steel) の固相拡散接合

 森
 慎之助・梅本
 実*・岡根
 功*

 (愛媛大学教育学部技術研究室)

 (平成6年4月28日受理)

Solid State Diffusion Bonding of Si₃N₄ to Ni-Cr-Mo Steel

Shinnosuke MORI, Minoru UMEMOTO and Isao OKANE Department of Techonlogy, Faculty of Education, Ehime University, Bunkyo-cho, Matsuyama 790 (Received April 28, 1994)

This paper is a fundamental study for bonding of Si_3N_4 to Ni-Cr-Mo Steel with using several different insert-metals. The cracks in ceramics close to the interface, the defects at the bonding interface and the mechanism of their occurrence have been investigated.

The results are summerized as follows:

- (1) When thickness of Ni insert metal reachs a certain critical value, cracks in ceramics are restrained.
- (2) The crack occured by decohesion at the edge of ceramics-insert metal interface still remains.
- (3) The layer involving microvoids at the ceramics-Ni interface exist. The thickness of layer depends on the bonding time, but not on the bonding pressure.

1. 緒 言

セラミックスは金属に比べて高温で高い強度を示し耐食性,耐摩耗性に優れているので新し

^{*}豊橋技術科学大学

⁽Department of Production System Engineering. Toyogashi University of Technology. Hibarigaoka, Tenpaku-cho. Toyohashi 440)

い素材としてその利用が期待されている.しかし,セラミックスは一般にぜい性であるため, その使用にあったてはじん性に富む金属材料との複合部材とすることが有効であると考えられ る.その複合化の方法として固相接合法が中心となっている.

セラミックスと金属の固相接合においては、両者の熱膨張係数差によって接合界面周辺に熱応力が生じ、それがセラミックス内での割れを引き起こす。良好な接合体を得るには高い強度を持つセラミックス/金属接合面をつくること、およびセラミックスと金属の熱膨張差から生ずる熱応力を緩和させることが重要である⁽¹⁾⁽²⁾. 金属の熱膨張係数がセラミックスのそれより一般に大きいのは、原子の結合の本質に由来するものであるため⁽³⁾に、これに対する対応は容易ではない.

本研究では高温構造用材料として注目されている窒化ケイ素と構造用鋼の固相拡散接合を行い、インサート材と接合強度の関係について検討した.

2. 実験材料および実験方法

セラミックスは、常圧焼結 Si₃N₄ (ϕ 19×5 mm)を使用した.金属には構造用鋼 SNCM 439 (ϕ 12×5 mm)を使用した.インサート材は低熱膨張金属としてモリブデン: Mo およびコ バール: Ko, 軟質金属としてニッケル: Ni を使用した.接合金属およびインサート材は、 それぞれ直径12 mm の棒状のものから、所定の厚さに切り出し、エメリー紙で1500番まで研 磨を行い、その後、アセトン中で超音波洗浄を行い使用した. Ni については、厚さ50 μ m の 箔も使用した、セラミックスはトリクレン中で超音波洗浄を行い実験に供した.接合材料およ びインサート材の機械的特性を表1に示す.

		熱膨張係数 x10 ⁻⁶ (/k)	ヤング率 (GPa)	ポアソン比	降伏応力 (MPa)
鋼材	SNCM	5.4	206	0.29	470
	Ni	13.3	196	0.31	167
インサート材	Ko	5.8	137	0.30	412
	Mo	5.1	323	0.32	676
セラミックス	$\mathrm{Si}_3\mathrm{N}^4$	3.2	274	0.25	

表1 各材料の機械的特性

接合実験には、高周波加熱式真空ホットプレスを用いた.材料を金属/インサート材/セラ ミックスの順序で重ね、カーボンで作製した治具に設置した.接合条件は真空中(3×10⁻⁴ Pa以下),接合温度1423K,接合時間1.8ks, 3.6ksおよび7.2ks,接合圧力4.2MPa, 10.9MPa および19.3MPa である.接合後、接合体における接合強度を調べるために、せん断治具を作 製し、引張せん断試験を行った.引張速度は0.5 mm/min である.

セラミックス/インサート材接合界面は接合体断面を光学顕微鏡および走査型電子顕微鏡に より観察を行った.

3. 実験結果および考察

3-1 低熱膨張金属をインサート材として 接合した場合

インサート材としてコバールおよびモリブデ ンを単層で用いて接合を行った. モリブデンを 単層で使用したものは接合が不可能であった. これはモリブデンのヤング率および硬度が高い ためセラミックスとの直接接合が不可能であっ たと思われる. コバールについては接合体が得 られたが、その接合強度は平均で30MPaと低 いものであった. その原因を明らかにするため にセラミックス/インサート材界面近傍におけ るコバール組織観察を行った.その結果を図1 に示す.図より結晶粒がセラミックス界面に近 ずくにつれて、小さくなっている様子がわかる. これは、接合が高周波加熱で行われるため、金 属とセラミックスの間で温度勾配が生じたもの と思われる.しかし,セラミックスにコバール が接合されていない箇所の結晶粒は、上述のよ うな傾向はみられなかった.そこで、接合界面 近傍におけるコバールのビッカース硬さ測定を 行った.その結果を図2に示す.図より界面ご く近傍は、非常に硬くなっていることがわかる. これより結晶粒の変化は、ある元素の拡散によ り起こったと思われる.この結晶粒の変化は, SNCM 鋼と接合されてるコバール側の界面近 傍でも起こっている.

低熱膨張金属を単層でインサート材として接 合した場合,モリブデンのようなヤング率およ び硬度が高い材料はセラミックスとの直接接合 が不可能であり,コバールのように硬度は高い がヤング率の低い材料はセラミックスとの接合 が可能であった.しかし,コバール硬度が高い ためセラミックス表面に完全に密着せず,低い 接合強度しか得られなかったと思われる.そこ で,軟質金属であるニッケルをインサート材と してセラミックスとの接合を試みた.



(a) コバールがセラミックスと接合された界面



(b) コバールがセラミックスと接合されなかった界面



図1 コバール/セラミックス界面近傍における 組織図

3-2 軟質金属をインサート材として接合した場合

ニッケルをインサート材として接合実験を行う場合のインサート材の組合せを、図3に示すような3種類とした.以下これらを(I),(II)および(II)型とした.



(I)型の接合後の試料断面を観察した結果, セラミックス内に熱応力に起因するき裂が発生 しているのが認められた.図4にセラミックス 内で観察されたき裂の一例を示す. これらのき 裂は,一般に図にもみられるように試料表面近 くのセラミックス/インサート材界面でのはく 離部分と連ながっている.このことから本接合 体でのき裂発生進展経路としては、試料表面か らセラミックス/インサート材界面にはく離が おこり, それがある程度試料内部にまで進展し た後にセラミックス内へのき裂として進展して いったものと考えられる. 一般に軟質金属イン サート材は, 接合内での熱応力を緩和する作用 を有することが知られている. そこで、ニッケ ルインサート材の厚さを種々変化させることに よる接合体セラミックス中のき裂発生の有無 (発生した場合にはその長さ)を調べた.図5 は本研究で用いた3種類の組合せインサート材 を使用したときのセラミックス内き裂長さのニ ッケル厚さによる変化をまとめて示したもので ある.3種類のインサート材ともにニッケル厚

さの増加とともにセラミックス内き裂長さは直 接的に減少していくのがわかる.また,直線の 傾きはインサート材の種類に依存し,き裂が発





図5 セラミックス内き裂長さに対するNi厚さ依
 存性

生しなくなる臨界ニッケル厚さはⅠ, Ⅱ, Ⅲ型の順で小さくなりそれぞれ0.5, 0.2, 0.1 mm であった. このことより, 軟質金属インサート材の厚さがある値以上になればセラミックス内 でのき裂発生が抑止されること, また, インサート材として熱膨張係数の小さな材料を適当に 組合せて用いることは, 軟質金属インサート材厚さの増大と同等の熱応力緩和能によりセラミ ックス内のき裂発生を抑止できることがわかった.

つぎに、せん断強度におよぼすニッケル厚さの影響を調べた.軟質金属ニッケルインサート 材の厚さを厚くすることにより、セラミックス内でのき裂発生が抑止されたことより、インサー ト材厚さの増大は、かかる接合体の強度改善にも寄与することが予想される.そこでインサー ト材としてニッケルのみを用いた(I)型における接合強度のニッケル厚さによる変化を調べ た.その結果を図6に示す.セラミックス内き裂が発生しなくなるニッケル厚さ0.5 mm 以上 で接合強度が上昇しているのが認められる.しかし、接合強度そのものはいずれもコバールを 単層で使用した時と同様に30MPa以下の低い値であった.その原因を明らかにするために、 接合後の試片断面を観察した結果、図7に示すようなセラミックス/インサート材界面端部で のはく離が認められた.このことより、せん断試験において、このはく離先端部に応力集中が 起こるために高いせん断強度が得られなかったものと思われる.(II)型および(II)型の場 合も同様に接合部材端部のセラミックス/インサート材界面におけるはく離が存在するため に、高いせん断強度は得られなかった.





図7 Si₃N₄界面でのはく離の様相

これらの結果より、ニッケルインサート材の厚さを厚くすることは熱応力の緩和によりセラ ミックス内でのき裂発生を抑止する効果を有するが、依然として接合部材端部セラミックス/ インサート材界面でのはく離によるき裂が残存することがわかった.

3-3 ボイド層の生成条件

セラミックス/ニッケル界面を観察した結 果,図8に示すようなボイド層が認められた. このボイド層の生成も接合強度に影響をおよぼ すと考えられる.そこで,ボイドの生成条件に ついて検討した.

接合時間に対するボイド層の厚さの変化について調べた.その結果を図9に示す.ボイド層 厚さと接合時間との間には明らかに直線関係が 認められる.つまり,ボイド層厚さ x と接合

ボイド層



図8 Si₃N₄界面でのボイド層

時間 t は次式で表される.

$$\mathbf{x} = \mathbf{0.104}\,\sqrt{\mathbf{t}} \tag{1}$$

このように、ボイド層厚さが時間の平方根に 比例することは、ボイド層が拡散機構により発 生. 成長していることを意味している.

つぎに、加圧力がボイド層に与える影響を調 べるために, 接合圧力を変化させてみた. その 結果を図10に示す.いずれの加圧力においても ボイド層厚さは7.5 µm 程度であり、ボイド層 厚さは接合圧力には影響されないことが確認さ れた.

このボイドが発生するメカニズムについては 種々検討されている が,現在なお不明な 点が多い. 一つにはニッケルのセラミックス中 への拡散が Si の Ni 中への拡散より速いため にニッケル中へカーケンダルボイドが発生する というものである. もう一つはセラミックスが 加熱されることによって分解し, N を発生す る. それがニッケル中に拡散して N2 の空孔を 作るというものである. 一般にセラミックスの





図10 ボイド層厚さの接合圧力依存性

分解は1473K以上で起こるが、ニッケルの存在によってその温度が1173K付近まで低下するこ とが知られている⁽⁶⁾.

これらの結果からボイド層の発生を抑えるには接合時間の短縮が考えられる.しかし、接合 時間は接合強度を左右する重要な因子の一つであるためボイド層の減少のために短くすること はできない.

4.結 Ē

本研究ではインサート材としてニッケル、コバールおよびモリブデンを用いてセラミックス と構造用鋼の固相拡散接合を行い.その接合強度におよぼすインサート材の影響について検討 した結果、以下のことが明らかとなった.

- 1. 低熱膨張金属を単層でインサート材として使用する場合は、材料自身が硬くセラミックス 表面と密着しにくい.
- 2. ニッケルインサート材の厚さがある値以上になればセラミックス内でのき裂発生が抑止さ れる.また,インサート材として熱膨張係数の小さな材料を適当に組み合わせて用いるこ とは、軟質金属インサート材厚さの増大と同等の熱応力緩和能を有する.
- 3. ニッケルインサート材を厚くすることは、熱応力の緩和によりセラミックス内でのき裂発 生を抑止する効果を有するが、依然として接合部材端部セラミックス/インサート材界面 でのはく離によるき裂が残存する.

4. セラミックス/ニッケル界面のボイド層厚さは接合時間に依存してる.しかし,接合圧力 はボイド層厚さにほとんど影響をおよぼさない.

参考文献

- (1) 菅沼ら,日本金属学会春期大会一般講演概要,1986, P124
- (2) 山本ら,日本金属学会春期大会一般講演概要,1986,P124
- (3) 石田洋一, セラミックス, 21 (1986) No.6
- (4) 高尾ら,日本セラミックス協会学術論文誌,98, P36-42,1990
- (5) 中尾ら, 溶接学会全国大会講演概要第36集, 1985, P68
- (6) 荒田ら, 溶接学会全国大会講演概要第37集, 1986, P132